2010年5月7日(金)、筑波大学 第1回「学際計算科学による新たな知の発見・統合・創出」シンポジウム

半導体デバイスにおけるキャリア輸送の 大規模分子動力学シミュレーション

早稲田大学 <u>神岡武文</u> 渡邊孝信(プロジェクトリーダ) EMCMD

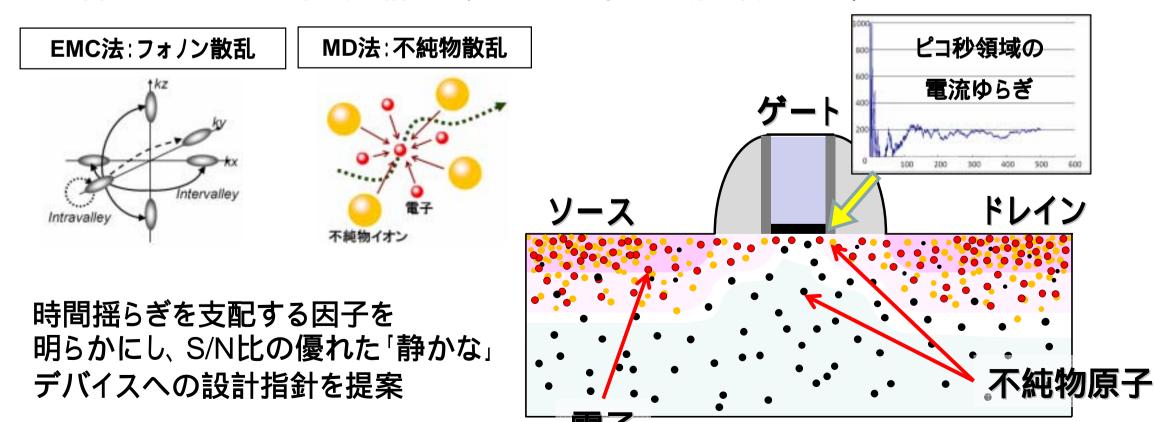
研究目的

現在の半導体デバイス工学の中心課題の一つである「電気特性揺らぎ」の解明に資する大規模シミュレーション技術を開発する。

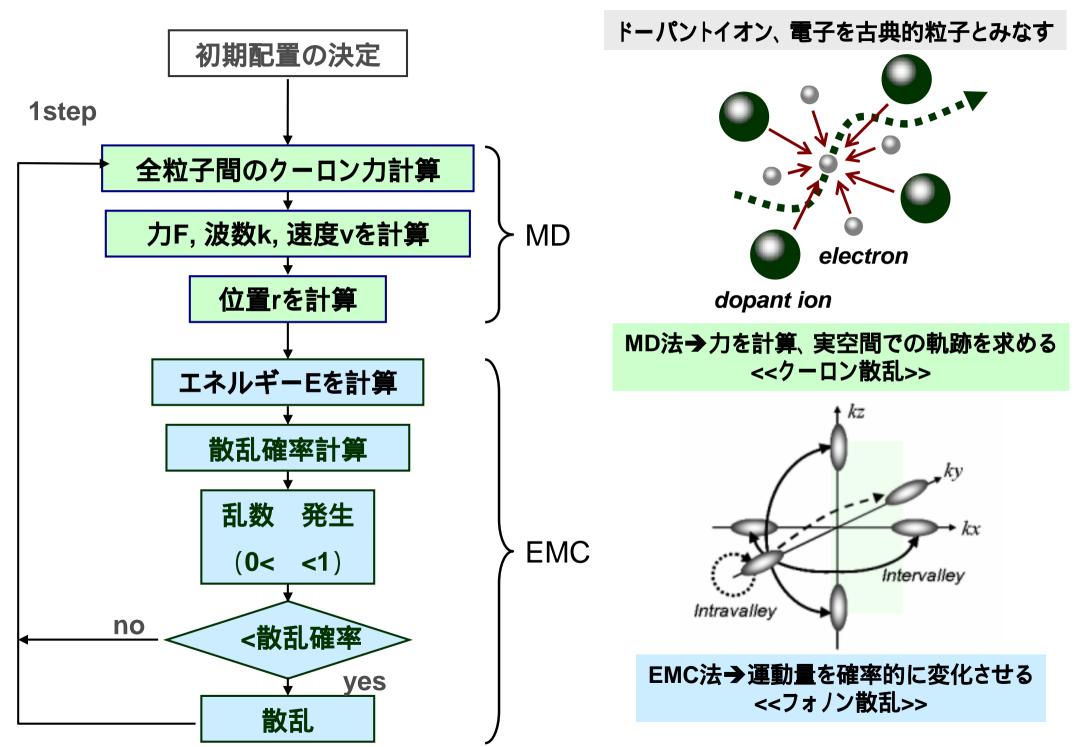
EMC-MD(Ensemble Monte Carlo – Molecular Dynamics)法

電子、不純物イオンを古典粒子として表現し、

各々のキャリアの軌跡を計算し、デバイス中の電流を再現する。



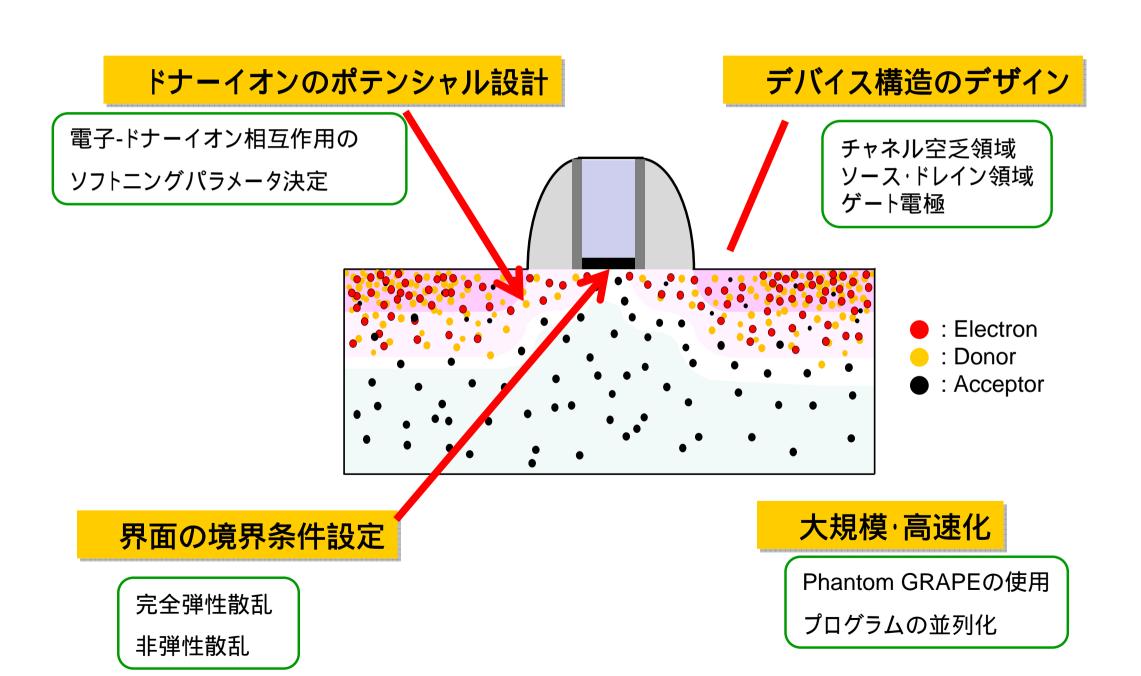
EMC-MD法



C. Jacoboni et al., Rev. Modern Phys., 55, No.3, July, 1983 Y. Kamakura et al., IEICE Trans. Electron., E86-C, no.3, 357, 2003

平成21年度後期- 学際共同利用での研究内容

nチャネルMOSFETのシミュレーションのための要素技術開発



ドナーイオンのポテンシャル設計

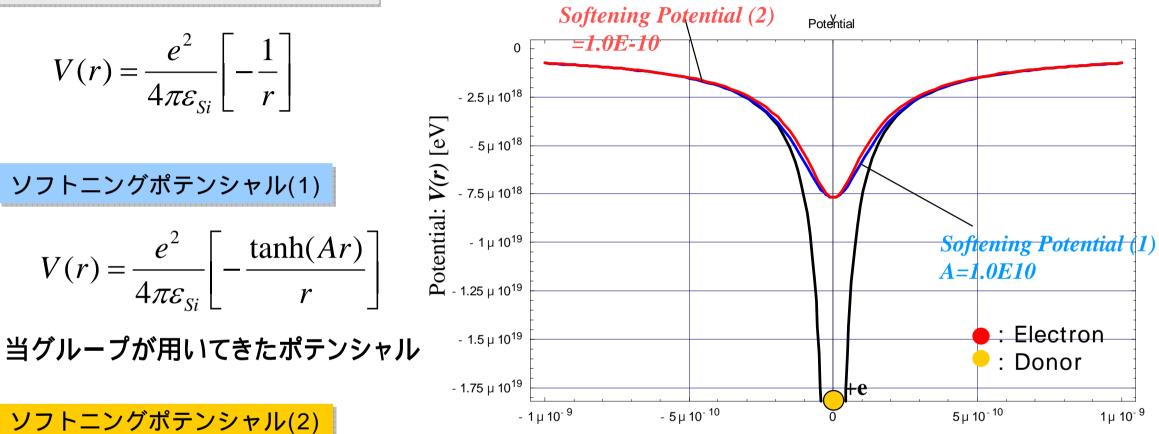
点電荷間のCoulomb相互作用

$$V(r) = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_{Si}} \left[-\frac{1}{r} \right]$$

$$V(r) = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_{Si}} \left[-\frac{\tanh(Ar)}{r} \right]$$

ソフトニングポテンシャル(2)

$$V(r) = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_{Si}} \left[-\frac{1}{(|r|^2 + \varepsilon^2)^{1/2}} \right]$$

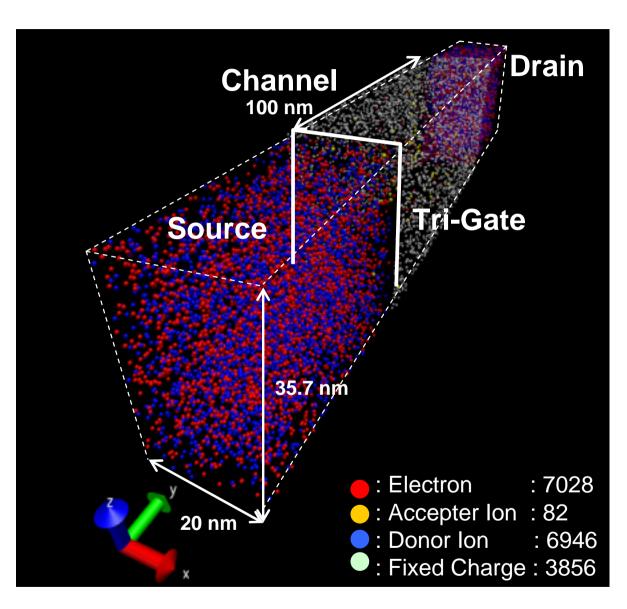


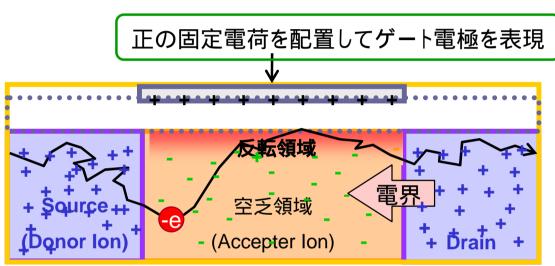
Distance: r [nm]

GRAPE ライブラリで用いられるポテンシャル

Phantom GRAvity PipE

Modeling: Tri-Gate MOS-FET



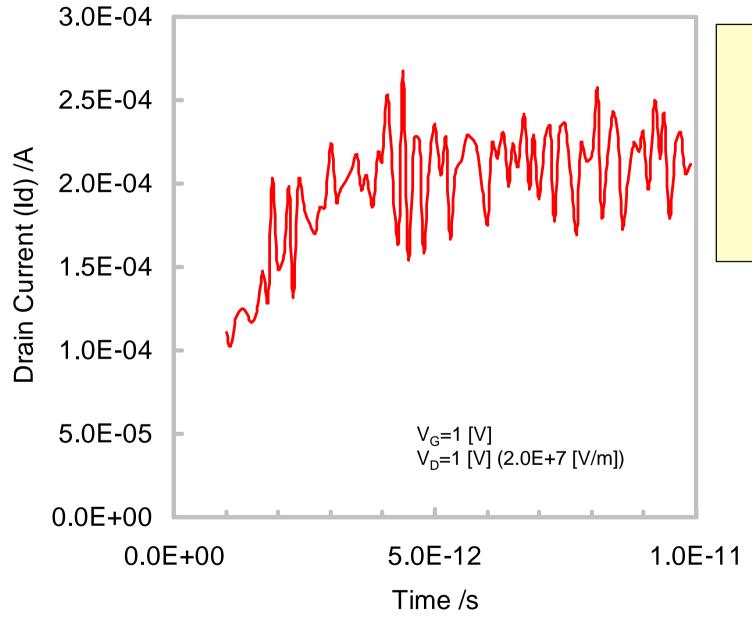


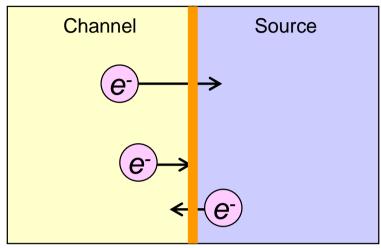
x軸方向からみた断面図

様々なデバイス構造で、 電気特性をシミュレートする。

ソース/ドレイン領域、酸化膜/ゲート電極界面を 含んだ「実デバイス寸法の系」のデバイスをモデリング

ドレイン電流の時間発展





$$I_{d} = \frac{\left(\sum_{SamplingStep} \Delta N_{ele}^{C \to D}\right) \times e}{\Delta t_{sampling}}$$

 $t_{sampling}$: サンプリング時間[s] $N_{ele}^{C->D}$: C/D界面を通過した電子数 e: elemental charge [C]

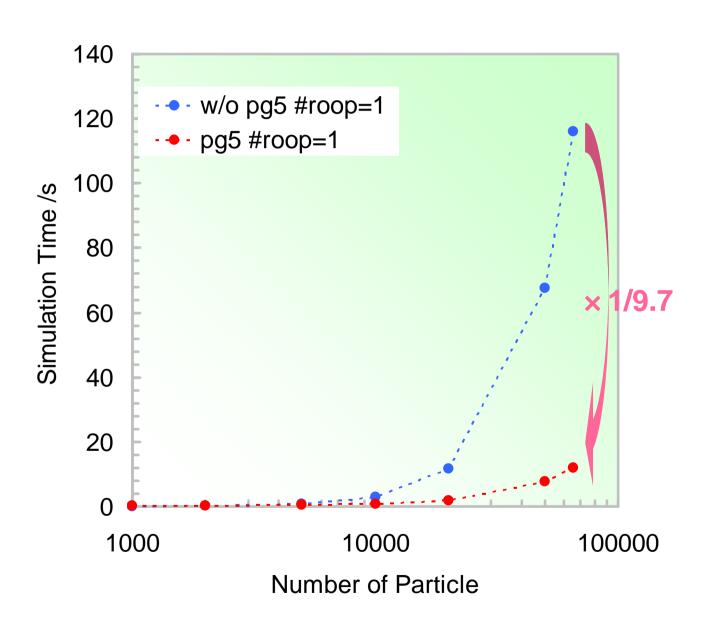
MD Time Step: 1.0E-16 [s]

1 [psec]経過後からI_dを計測 (Sampling Rate: 1E+13 [Hz])

ピコ秒領域のドレイン電流揺らぎを計測→揺らぎの周波数、S/N比、を解析

Phantom GRAPEによるCoulomb相互作用計算の高速化

T2K-Tsukuba上でPhantom-GRAPEライブラリを利用



10000電子系で3.5倍、65535電子系で9.7倍、高速化することを確認

平成22年度の目標

- 平成21年度に準備した要素技術を動員し、微細MOSFETの系統的なデバイスシミュレーションを実施する。
 - ・デバイスの微細化に伴って顕在化する定常的な特性揺らぎ
 - ・ピコ秒オーダーの短い時間スケールにおける電流揺らぎの定量予測

- □ プログラムの並列化による計算の更なる高速化
 - ・相互作用を有限長でカットオフし、領域分割で並列化
 - ・高速多重極子展開による並列化